# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 5月10日

出願番号

Application Number: 特願200

特願2001-140015

出 願 人
Applicant(s):

日産化学工業株式会社

2001年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





#### 特2001-140015

【書類名】 特許願

【整理番号】 4235000

【提出日】 平成13年 5月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C01F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会

社中央研究所内

【氏名】 太田 勇夫

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会

社中央研究所内

【氏名】 西村 透

【発明者】

【住所又は居所】 富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業株式会社

富山工場内

【氏名】 谷本 健二

【特許出願人】

【識別番号】 000003986

【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社

【代表者】 藤本 修一郎

【電話番号】 047-465-1120

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005212

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 ネオジムを含有する酸化セリウムゾル

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 0.005~1 $\mu$ mの粒子径を有し、且つNd/(Ce+Nd)モル比に換算して0.001~0.5の割合でネオジム化合物を成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾル。

【請求項2】 下記第1工程及び第2工程:

第1工程:水性媒体中でセリウム(III)塩とネオジム(III)塩をNd/(Ce+Nd)モル比に換算して $0.001\sim0.5$ の割合で混合した水溶液と、アルカリ性物質を $(OH^-)$  /  $(Ce^{3+}+Nd^{3+})$  のモル比として $3\sim30$ の割合で反応させて水酸化セリウム(III)と水酸化ネオジム(III)が均一に混合された懸濁液を生成する工程、及び、

第2工程:得られた懸濁液に $10\sim95$   $\mathbb C$ の温度で酸素又は酸素を含有するガスを吹き込む工程を経由して得られ、 $0.005\sim1~\mu$  mの粒子径を有し、且つN d  $\mathbb Z$  ( $\mathbb Z$  ( $\mathbb Z$  ( $\mathbb Z$  ) モル比に換算して $\mathbb Z$  )  $\mathbb Z$  0.5 の割合でネオジム化合物を成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾルの製造方法。

【請求項3】 第1工程が大気開放下で行われる請求項2に記載の製造方法

【請求項4】 第1工程が不活性ガス雰囲気下で行われる請求項2に記載の 製造方法。

【請求項5】 セリウム(III)塩が硝酸セリウム(III)、硝酸セリウム(III)アンモニウム、硫酸セリウム(III)、硫酸セリウム(III)アンモニウム、塩化セリウム(III)、炭酸セリウム(III)、酢酸セリウム(III)、蓚酸セリウム(III)又はこれらの混合物である請求項2乃至請求項4のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項6】 ネオジム(III) 塩が硝酸ネオジム(III)、塩化ネオジム(III)、酢酸ネオジム(III)、蓚酸ネオジム(III)又はこれらの混合物である 請求項2乃至請求項5のいずれか1項に記載の製造方法。 【請求項7】 アルカリ性物質が、アルカリ金属水酸化物、有機塩基またはこれらの混合物である請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本願発明は、ネオジム化合物を含み酸化セリウムが主成分である粒子を媒体に 分散したゾルの製造方法に関するものである。ネオジムを成分として含み酸化セ リウムを主成分とする粒子は、研磨剤、紫外線吸収材料、触媒用材料及び燃料電 池用材料等に利用することができる。

[0002]

【従来の技術】

特開昭56-131686号公報には、セリウム塩と塩基性溶液と陰イオンが不溶性希土類酸化物を形成できる塩の溶液を同時に混合し、得られた沈殿物を濾別し、100~600℃で乾燥し、600~1200℃で焼成し、粉砕したネオジムを含有する酸化セリウム粉末が開示されている。

[0003]

特開平10-95614 号公報には、不活性ガス雰囲気下に水性媒体中にセリウム(III)塩とアルカリ性物質を $3\sim30$ の( $OH^-$ )/( $Ce^{3+}$ )のモル比で反応させて水酸化セリウム(III)の懸濁液を生成した後、直ちに該懸濁液を大気圧下、 $10\sim95$   $\mathbb C$  の温度で酸素又は酸素を含有するガスを吹き込み0.00  $5\sim5~\mu$  mの粒子径を有する結晶性酸化セリウム粒子の製造方法が開示されている。

[0004]

特公昭63-27389号公報には、酸化第二セリウム40~99.5重量%とランタニド及びイットリウムから成る群より選ばれる他の希土類元素の無色の酸化物の少なくとも一種0.5~60重量%とを含有する研磨組成物が開示されている。

[0005]

特公昭60-35393号公報には、Ln<sub>2-X</sub>Ce<sub>X</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>(但しXは0以上

2未満の数を示す。) 相当するセリウム系研磨組成物が開示されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

乾燥と焼成と粉砕を行いネオジムを含有する酸化第二セリウム粉末を製造する 方法では、粉砕により微粒子化しているため粒子径が不揃いであり、またサブミ クロンまでしか微粒子化できない。

[0007]

そこで、水溶液中で核生成及び結晶成長を行い、ネオジムを成分として含み酸 化セリウムを主成分とする粒子の製造を行い、粒子径が均一でしかもサブミクロ ン以下の微粒子を製造する方法を試み本発明に至った。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本願発明は第1観点として、0.005~1μmの粒子径を有し、且つNd/ (Ce+Nd) モル比に換算して  $0.001\sim0.5$  の割合でネオジム化合物を 成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾル、

第2観点として、下記第1工程及び第2工程:

第1工程:水性媒体中でセリウム (III) 塩とネオジム (III) 塩をNd/(Ce +Nd) モル比に換算して  $0.001\sim0.5$  の割合で混合した水溶液と、アル カリ性物質を  $(OH^-)$  /  $(Ce^{3+}+Nd^{3+})$  のモル比として  $3\sim3$  0 の割合で 反応させて水酸化セリウム (III) と水酸化ネオジム (III) が均一に混合された 懸濁液を生成する工程、及び、

第2工程:得られた懸濁液に10~95℃の温度で酸素又は酸素を含有するガス を吹き込む工程を経由して得られ、 0. 0 0 5  $\sim$  1  $\mu$  mの粒子径を有し、且つ N d / (Ce+Nd) モル比に換算して $0.001\sim0.5$  の割合でネオジム化合 物を成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾルの製 造方法、

第3観点として、第1工程が大気開放下で行われる第2観点に記載の製造方法

第4観点として、第1工程が不活性ガス雰囲気下で行われる第2観点に記載の

## 製造方法、

第5観点として、セリウム(III)塩が硝酸セリウム(III)、硝酸セリウム(III)アンモニウム、硫酸セリウム(III)、硫酸セリウム(III)アンモニウム、塩化セリウム(III)、炭酸セリウム(III)、酢酸セリウム(III)、蓚酸セリウム(III)、乙はこれらの混合物である第2観点乃至第4観点のいずれか一つに記載の製造方法、

第6観点として、ネオジム(III)塩が硝酸ネオジム(III)、塩化ネオジム(III)、酢酸ネオジム(III)、蓚酸ネオジム(III)又はこれらの混合物である第2観点乃至第5観点のいずれか一つに記載の製造方法、及び

第7観点として、アルカリ性物質が、アルカリ金属水酸化物、有機塩基または これらの混合物である第2観点乃至第6観点のいずれか一つに記載の製造方法で ある。

[0009]

## 【発明の実施の形態】

本願発明で得られるゾルは、 $0.005\sim1~\mu$  mの粒子径を有し、且つN d / (Ce+N d) モル比に換算して $0.001\sim0.5$  の割合でネオジム化合物を成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾルである。この酸化セリウムを主成分とする粒子は上記第1工程及び第2工程を経由して得られ、(i)  $0.005\sim1~\mu$  mの粒子径を有すること、及び(ii) N d / (Ce+N d) モル比に換算して $0.001\sim0.5$ 、好ましくは $0.005\sim0$ . 15の割合でネオジム化合物を成分に含有することを特徴に備えている。

[0010]

本願発明の酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾルは、第1工 程及び第2工程を経由して得られる。

[0011]

第1工程は、大気開放下で行われる方法と、不活性ガス雰囲気下で行われる方 法がある。

[0012]

第1工程が大気開放下で行われる方法では、懸濁液中の水酸化セリウム(III

)と水酸化ネオジム(III)は第1工程中乃至それに続く第2工程で直ちに、酸素含有ガスにより酸化される為に、懸濁液中に多数の核が発生し得られる粒子の粒子径分布が広くなる。第1工程は $0\sim95$   $\mathbb C$  の温度で、 $10分\sim3$  時間で行われる。 第2工程は $10\sim95$   $\mathbb C$  の温度で、 $1\sim20$  時間で行われる。また第1工程及び第2工程は共に常圧下で行われる。

## [0013]

一方、第1工程が不活性ガス雰囲気下で行われる方法では、懸濁液中の水酸化セリウム(III)と水酸化ネオジム(III)は酸化されずに水酸化物の状態で第2工程が行われるために、得られる粒子の粒子分布は狭い。第1工程は0~95℃の温度で、10分~3時間で行われる。第1工程が終了後、直ちに第2工程が行われる。第2工程は10~95℃の温度で、1~20時間で行われる。また第1工程及び第2工程は共に常圧下で行われる。

## [0014]

第1工程で使用されるセリウム (III) 塩としては、硝酸セリウム (III)、硝酸セリウム (III) アンモニウム、硫酸セリウム (III)、硫酸セリウム (III) アンモニウム、塩化セリウム (III)、炭酸セリウム (III)、酢酸セリウム (III)、蓚酸セリウム (III)、蓚酸セリウム (III) またはこれらの混合物などの水溶性の3 価のセリウム塩が挙げられる。

## [0015]

またネオジム (III) 塩としては、硝酸ネオジム (III) 、塩化ネオジム (III ) 、炭酸ネオジム (III) 、酢酸ネオジム (III) 、蓚酸ネオジム (III) またはこれらの混合物などの水溶性の3価のネオジム塩が挙げられる。

## [0016]

不活性ガスとしては、窒素ガス、アルゴンガス等が挙げられるが、特に窒素ガスが好ましい。

## [0017]

アルカリ性物質は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸 化物またはアンモニア、アミン、水酸化四級アンモニウム等の有機塩基が挙げら れ、特に、アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムが好ましく、これら を単独または混合物として使用することができる。

[0018]

第2工程において、酸素を含有する気体は空気、酸素、酸素などの酸化性ガスと窒素などの不活性ガスとの混合ガスなどが挙げられるが、空気が経済性、取扱い面から好ましい。これらガスの吹き込みは、反応容器にガス導入管を取り付け、ガス導入管の先端のノズルを反応液中に浸けてガスが導入される。

[0019]

上記の製造方法によって得られた酸化セリウムを主成分とする粒子は、反応装置よりスラリーとして取り出し、限外濾過法またはフィルタープレス洗浄法などにより水溶性の不純物を除去することができる。

[0020]

本願発明によって得られるネオジムを成分として含み酸化セリウムが主成分である粒子は、透過型電子顕微鏡(TEM)観察を行ったところ粒子径が0.005~ $1\mu$ mの範囲にある。またNd/(Ce+Nd)モル比に換算して、例えば $0.001\sim0.15$ の粒子を110℃で乾燥して、X線回折装置により回折パターンを測定したところ、回折角度 $2\theta=28.6^{\circ}$ 、 $47.5^{\circ}$  及び $56.4^{\circ}$  に主ピークを有し、ASTMカード34-394に記載の立方晶系の結晶性の高い酸化セリウム粒子であることが分かった。

[0021]

またこのネオジムを成分として含み酸化セリウムが主成分である粒子のガス吸着法(BET法)による比表面積値は、 $2\sim200\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である。

[0022]

本願発明のネオジムを含有する酸化セリウムで、ネオジムを含有する好ましい量はNd/(Ce+Nd) モル比で $0.001\sim0.5$ であり、より好ましくは $0.005\sim0.3$ 、最も好ましくは $0.005\sim0.15$ である。

[0023]

このモル比が 0.001より少ない場合は、ネオジム化合物含有の効果がなく、また 0.5より多くなると酸化セリウム粒子の結晶性が悪くなる。

[0024]

本願発明で得られる粒子中に含まれるその他の希土類元素としては、ランタン、プラセオジム、サマリウム、ガドリニウム等があげられるが、ネオジム化合物 含有の効果を阻害するものではない。

[0025]

本願発明で得られる粒子中に含まれる成分のネオジムは、酸化ネオジムや水酸 化ネオジム等の形態で含有され、酸化セリウムと共に粒子を形成するが、一部は 酸素原子を挟んでセリウム原子とネオジム原子の化学結合を生じていると考えら れる。

[0026]

本願発明によって得られたネオジム化合物を成分として含み酸化セリウムが主成分である粒子は、水媒体、水溶性有機溶媒または水と水溶性有機溶媒の混合溶媒に再分散させる事によりゾルとして研磨剤、紫外線吸収材料、触媒用材料及び燃料電池用材料等にすることができる。

[0027]

本願発明によって得られたネオジム化合物を成分として含み酸化セリウムが主成分である粒子を媒体に分散したゾルは、長時間放置すると粒子の一部が沈降するが、撹拌により容易に再分散することができ元の状態に戻るため、常温に保存して1年以上安定である。

[0028]

#### 【実施例】

### 実施例1

2 Lのガラス製反応槽にNH $_3$ / (Ce $^{3+}$ +Nd $^{3+}$ ) = 8 (モル比) に相当する28%のアンモニア水溶液169 gと純水69 gを仕込み、液温を30℃に保ちながらのガラス製のノズルより0.5 L/分の窒素ガスの吹き込みを開始した。1 Lのガラス製容器にCe $O_2$ に換算した濃度が11.5 重量%で純度が99.9%の硝酸セリウム (III) 水溶液684 gと、Nd $_2O_3$ に換算した濃度が10.5 重量%の純度が99.99%以上の硝酸ネオジム (III) 水溶液12.5 gと純水65 gを混合した。この混合水溶液は、ネオジムをNd/(Ce+Nd)に換算したモル比で10.002の割合で含有していた。この混合水溶液を攪拌し

ながら30分かけて徐々に、2Lのガラス製反応槽に添加して水酸化物の懸濁液を得た。続いてこの懸濁液を80℃まで昇温させた後、ガラス製のノズルからの吹き込みを窒素ガスから0.5L/分の空気に切り替えセリウム(III)がセリウム(IV)にする酸化反応を開始した。7時間50分で酸化反応が終了した。反応が終了した液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH8.3、電気伝導度135mS/cmの反応液が得られた。

### [0029]

反応液をヌッチェで洗浄を行い、固形分 2 6. 3 重量%、 p H 5. 3、電気伝導度 2 4  $\mu$  S / c m の白色スラリー 3 0 0 g が得られた。洗浄したスラリーを透過型電子顕微鏡(T E M)で観察したところ 5 0 ~ 1 5 0 n m の粒子であった。この粒子の収率は、ほぼ 1 0 0 %であった。また、微粒子を乾燥して粉末 X 線回折を測定したところ、回折角度 2  $\theta$  = 2 8. 6°、4 7. 5°及び 5 6. 4°に主ピークを有し、A S T M カード 3 4 - 3 9 4 に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。この粒子は、ネオジムを N d / (C e + N d)に換算したモル比で 0. 0 2 の割合で含有していた。また C A P A - 7 0 0 (堀場製作所(株)製)で測定した遠心沈降法による粒子径は 0. 4 2  $\mu$  m であり、N 4 (COULTER ELECTRONICS, INS製)で測定した動的光散乱法による粒子径は、3 0 0 n m であった。また窒素吸着法による比表面積は、2 0. 3 m  $^2$  / g であった。

#### [0030]

この洗浄した粒子に硝酸を $HNO_3/CeO_2=0$ . 12重量%添加し、更に純水で固形分10重量%に調整し、pH3. 9、電気伝導度108 $\mu$ S/cm、粘度1. 9mPa·Sのゾルが得られた。

#### [0031]

#### 実施例2

1 Lのガラス製反応槽に実施例1で得られた固形分26.3重量%、pH5.3、電気伝導度24μS/cmの白色スラリー188gを仕込み、30%の炭酸アンモニウム水溶液67gを添加後、90℃まで昇温させた後、6時間保持した。反応液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH10.1、電気伝導度6.3

m S/c mの反応液が得られた。反応液をヌッチェで洗浄を行い、固形分 2 6. 1 重量%、 p H 7. 1、電気伝導度  $14 \mu$  S/c mの白色スラリー 150 g が得られた。このスラリーを透過型電子顕微鏡(T E M)で観察したところ粒子径に変化はなかった。また、微粒子を乾燥して粉末 X 線回折を測定したところ、 A S T M カード 34-394 に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。またこの粒子は、ネオジムを N d / (C e + N d) に換算してモル比で 0.02 の割合に含有していた。

[0032]

この洗浄した粒子に硝酸を $\mathrm{HNO_3/CeO_2} = 0$ . 12重量%添加し、更に純水で固形分10重量%に調整し、 $\mathrm{pH3}$ . 9、電気伝導度 $108\mu\mathrm{S/cm}$ 、粘度1.  $3\mathrm{mPa}$ ·Sのゾルが得られた。

[0033]

### 実施例3

2 Lのガラス製反応槽にN  $H_3$  /  $(Ce^{3+}+Nd^{3+})=8$  (モル比)に相当する 2 8%のアンモニア水溶液 1 6 9 gと純水 1 9 gを仕込み、液温を 3 0  $\mathbb C$  に保ちながらのガラス製のノズルより 0 . 5 L / 2 の空素ガスの吹き込みを開始した。 1 Lのガラス製容器に $CeO_2$  に換算した濃度が 1 1 . 5 重量%で純度が 9 2 . 9 %の硝酸セリウム(III)水溶液 6 6 8 gと、 $Nd_2O_3$  に換算した濃度が 1 2 . 2 3 に換算した濃度が 1 2 3 に換算した悪度が 2 9 2 9 %以上の硝酸ネオジム(III)水溶液 2 9 . 2 3 gと純水 2 6 4 gを混合した。この混合水溶液は、ネオジムを 2 7 d / 2 7 c に換算してモル比で 2 0 . 2 5 の割合で含有していた。この混合水溶液を攪拌しながら 2 3 の分かけて徐々に、2 2 L のガラス製反応槽に添加して水酸化物の懸濁液を得た。続いてこの懸濁液を 2 8 0 2 まで昇温させた後、ガラス製のノズルからの吹き込みを窒素ガスから 2 6 とまで昇温させた後、ガラス製のノズルからの吹き込みを窒素ガスから 2 6 によいよいないり替えセリウム(III)がセリウム(IV)にする酸化反応を開始した。 2 6 時間 2 9 ので酸化反応が終了した。反応が終了した液を室温に戻し、白色の微粒子を有する 2 2 1 年 3 4 m S 2 c m の反応液が得られた。

[0034]

反応液をヌッチェで洗浄を行い、固形分25.5重量%、pH5.2、電気伝

導度  $28 \mu \text{ S/cm}$ の白色スラリー 314 gが得られた。洗浄したスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ $50 \sim 150 \text{ n}$  mの粒子であった。また、微粒子を乾燥して粉末 X 線回折を測定したところ、A STM カード 34 - 394 に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。この粒子は、ネオジムをN d / (C e + N d) に換算してモル比で 0.05 の割合に含有していた。またC APA - 700 (堀場製作所 (株) 製) で測定した遠心沈降法粒子径は  $0.64 \mu \text{ m}$ であり、N4 (COULTER ELECTRONICS, INS製) で測定した動的光散乱法による粒子径は、353 n mであった。また窒素吸着法による比表面積は、 $23.6 \text{ m}^2$  / g であった。

#### [0035]

1 Lのガラス製反応槽に洗浄したスラリー314gを仕込み、30%炭酸アンモニウム水溶液133gを添加後、90℃まで昇温させた後、6時間保持した。反応液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH10.0、電気伝導度7.0mS/cmの反応液が得られた。反応液をヌッチェで洗浄を行い、固形分26.6重量%、pH7.5、電気伝導度33μS/cmの白色スラリー300gが得られた。このスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ粒子径に変化はなかった。また、微粒子を乾燥して粉末X線回折を測定したところ、ASTMカード34-394に記載の立方晶系の結晶性酸化第二セリウムの特性ピークと一致した。またこの粒子は、ネオジムをNd/(Ce+Nd)に換算してモル比で0.05の割合に含有していた。

#### [0036]

この洗浄した粒子に硝酸を $HNO_3/CeO_2=0$ . 12重量%添加し、更に純水で固形分10重量%に調整し、pH4. 2、電気伝導度127 $\mu$ S/cm、粘度1. 5mPa・Sのゾルが得られた。

#### [0037]

#### 比較例1

500 Lのグラスライニング製反応槽に純水  $44.3 \text{ kg} \times \text{NH}_3/\text{Ce}^{3+}=$ 6 (モル比) に相当する 25%のアンモニア水溶液  $94.8 \text{ kg} \times \text{を仕込み}$ 、液温を 30%に保ちながらの樹脂製のノズルより  $3 \text{ Nm}^3$  /時間の窒素ガスを吹き込

み、 $CeO_2$ に換算した濃度が7.84重量%の純度が99.9%の硝酸セリウム (III) 508.0kgを攪拌しながら30分かけて徐々に添加して水酸化物の懸濁液を得た。続いてこの懸濁液を75℃まで昇温させた後、樹脂製のノズルからの吹き込みを窒素ガスから4 $Nm^3$ /時間の空気に切り替えセリウム (III) がセリウム (IV) にする酸化反応を開始した。5時間で酸化反応が終了した。反応が終了した液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH9.4、電気伝導度 19mS/cmの反応液が得られた。

[0038]

反応液をロータリーフィルタープレス(コトブキ技研製)で洗浄を行い、固形分19.3 kg、pH9.1、電気伝導度81  $\mu$  S/c mの白色スラリー173 kgが得られた。洗浄したスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ40~100 n mの粒子であった。この粒子の収率は、ほぼ100%であった。また、微粒子を乾燥して粉末 X線回折を測定したところ、ASTMカード34-394 に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。また窒素吸着法による比表面積は、28.0 m²/gであった。

[0039]

この洗浄した粒子に硝酸を $\mathrm{HNO_3/CeO_2} = 0$ . 12重量%添加し、更に純水で固形分<math>10重量%に調整し、 $\mathrm{pH4}$ .  $4、電気伝導度<math>125\mu\mathrm{S/cm}$ 、粘度 $1.4\mathrm{mPa}$ ·Sのゾルが得られた。

[0040]

比較例 2

反応が終了した液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH9.4、電気伝導度119mS/cmの反応液が得られた。

[0041]

反応液をロータリーフィルタープレス(コトブキ技研製)で洗浄を行い、固形分19.3 kg、pH9.1、電気伝導度81 $\mu$ S/cmの白色スラリー173 kgが得られた。洗浄したスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ40~100nmの粒子であった。この粒子の収率は、ほぼ100%であった。また、微粒子を乾燥して粉末X線回折を測定したところ、ASTMカード34-394に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。

[0042]

この洗浄スラリー173kgを再び500Lのグラスライニング製反応槽に仕込み、更に純水47.2kg、炭酸水素アンモニウム16.5kg及び25%アンモニア水14.2kgを仕込み、90℃まで昇温させた後、6時間保持した。反応液を室温に戻し、白色の微粒子を有するpH10.5、電気伝導度16.1mS/cmの反応液が得られた。反応液をロータリーフィルタープレスで洗浄を行い、固形分23.2重量%、pH5.5、電気伝導度26 $\mu$ S/cmの白色スラリー150kgが得られた。このスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ粒子径に変化はなかった。また、微粒子を乾燥して粉末X線回折を測定したところ、ASTMカード34-394に記載の立方晶系の結晶性酸化セリウムの特性ピークと一致した。またCAPA-700(堀場製作所(株)製)で測定した遠心沈降法粒子径は0.48 $\mu$ mであり、N4(COULTER ELECTRONICS,INS製)で測定した動的光散乱法による粒子径は、323nmであった。窒素吸着法による比表面積は、26.8 $m^2$ /gであった。

[0043]

この洗浄した粒子に硝酸を $HNO_3/CeO_2=0$ . 12重量%添加し、更に純水で固形分<math>10重量%に調整し、pH4.  $9、電気伝導度<math>156\mu$ S/cm、粘度1. 4mPa·Sのゾルが得られた。

[0044]

比較例3

2 Lのガラス製反応槽にN H $_3$ /N d  $^{3+}$  = 8 (モル比)に相当する2 5%のアンモニア水溶液 2 5 3 g を仕込み、液温を3 0  $\mathbb{C}$  に保ちながらガラス製のノズルより 0 . 5 L/0 の空素ガスの吹き込みを開始した。1 Lのガラス製容器にN d 2 O $_3$  に換算した濃度が 1 4 . 0 重量%、純度が 9 9 . 9 9%以上の硝酸ネオジム (III)水溶液 5 6 8 g を溶かし、攪拌しながら 3 0分かけて徐々に、2 Lのガラス製反応槽に添加して水酸化物の懸濁液を得た。続いてこの懸濁液を8 0  $\mathbb{C}$  まで昇温させた後、ガラス製のノズルからの吹き込みを窒素ガスから 0 . 0 5 L/0 の空気に切り替え、0 7時間で空気を吹き込んだ。反応液を室温に戻し、白色の微粒子を有する 0 H 8 . 0 、電気伝導度 0 5 0 m S/0 c mの反応液が得られた。

[0045]

反応液をヌッチェで洗浄を行い、固形分 20.5 重量%、pH7.8、電気伝導度  $150\mu$  S/c mの白色スラリー 370g が得られた。洗浄したスラリーを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ数  $\mu$  mの針状粒子であった。また、微粒子を乾燥して粉末 X線回折を測定したところ、ASTMカード 6-601 に記載の水酸化ネオジムの特性ピークと一致した。

[0046]

実施例 $1\sim3$ 及び比較例 $1\sim2$ で得られたゾルを研磨液として研磨試験を行った。

[0047]

研磨機(商品名:ラップマスター18、ラップマスター社製)、

研磨布:ポリウレタン含浸の不織布ポリテックスDG(ロデール・ニッタ社製)、

被研磨物:石英ガラス(φ95.5mm)、

回転数:40 r p m、

研磨圧力: 80g/cm<sup>2</sup>、

研磨時間:10分間で行った。

[0048]

実施例1で得られたゾルを用いた研磨試験では研磨速度が $1.4 \mu m$ /時間であり、研磨面は良好であった。

[0049]

実施例 2 で得られたゾルを用いた研磨試験では研磨速度が 2 .  $1~\mu$  m/時間であり、研磨面は良好であった。

[0050]

実施例3で得られたゾルを用いた研磨試験では研磨速度が2.4 μ m/時間であり、研磨面は良好であった。

[0051]

・比較例1で得られたゾルを用いた研磨試験では研磨速度が0.7μm/時間であり、研磨面は実施例1で使用したゾルの方が良好であった。

[0052]

比較例2で得られたゾルを用いた研磨試験では研磨速度が1.1μm/時間であり、研磨面は実施例1及び2で使用したゾルの方が良好であった。

[0053]

実施例1と比較例1を比較すると、実施例1は、比較例1に比べ研磨速度が速 く、しかも研磨面は良好であることがわかる。

[0054]

アンモニウム塩(例えば、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム)で表面 改質した実施例2及び3と比較例2の場合も、実施例2及び3の方が比較例2に 比べ研磨速度が速く、しかも研磨面は良好であることがわかる。

[0055]

【発明の効果】

本願発明は水性媒体中にセリウム(III)塩とネオジム(III)塩をNd/(Cetnormale etnormale tnormale tnormale

[0056]

セリウム (III) 塩とネオジム (III) 塩を混合しアルカリを添加して得られる

懸濁液が生じる第1工程を、大気開放化で行うか、不活性ガス雰囲気下で行うかによって、最終的に得られる酸化セリウムを主成分とする粒子の粒子径分布が異なる。大気開放化で行われる方法では粒子径分布が広くなり、不活性ガス雰囲気下で行われる方法では粒子径分布が狭くなる。

[0057]

本願発明により得られたネオジム化合物を成分として含み酸化セリウムが主成分である粒子は、シリカを主成分とする基板の研磨剤に適しており、研磨剤として高速研磨が可能で、しかも高品質面が得られる。

[0058]

そのため、CMP(ケミカルメカニカルポリシング: Chemical Mechanical Polishing)として好適である。特に、保護膜として用いられる窒化珪素膜にダメージを与えることなく精密に研磨することができるため、STI(トレンチ分離: Shallow Trench Isolation)と通常称されている半導体デバイスの素子分離工程に用いる研磨剤として好適である。また、シロキサン系、有機ポリマー系、多孔質材料系、CVDポリマー系等の半導体デバイスの層間絶縁膜用低誘電率材料の研磨に用いる研磨剤としても好適である。シロキサン系の材料としては、水素化メチルシルセスキオキサン、メチルシルセスキオキサン、水素化メチルシルセスキオキサン、メチルシルセスキオキサン、水素化メチルシルセスキオキサンが挙げられる。有機ポリマー系の材料の例としては、ポリアリーレンエーテル、熱重合性炭化水素、パーフロロ炭化水素、ポリキロリン、フッ素化ポリイミドが挙げられる。多孔質材料系の材料の例としては、キセロゲル、シリカコロイドが挙げられる。CVDポリマー系の材料の例としては、フロロカーボン、芳香族炭化水素ポリマー、シロキサン系ポロマーが挙げられる。

[0059]

本願発明の研磨剤は、タンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウム等の光学結晶材料、窒化アルミニウム、アルミナ、フェライト、ジルコニア等のセラミックス材料、アルミニウム、銅、タングステンなどの金属の研磨に適応できる。

[0060]

本願発明により得られるゾルは、研磨剤以外にも、紫外線吸収材料、触媒用材料及び燃料電池用材料等に利用することができる。

## 【図面の簡単な説明】

### 【図1】

図1は実施例2、実施例3、及び比較例1で得られた粒子の粉末X線回折のチャートを示す。

#### 【図2】

実施例2で得られた粒子の粒子構造を示す透過型電子顕微鏡写真を示す。倍率 は20万倍である。

#### . 【図3】

実施例3で得られた粒子の粒子構造を示す透過型電子顕微鏡写真を示す。倍率 は20万倍である。

#### 【図4】

比較例1で得られた粒子の粒子構造を示す透過型電子顕微鏡写真を示す。倍率 は20万倍である。

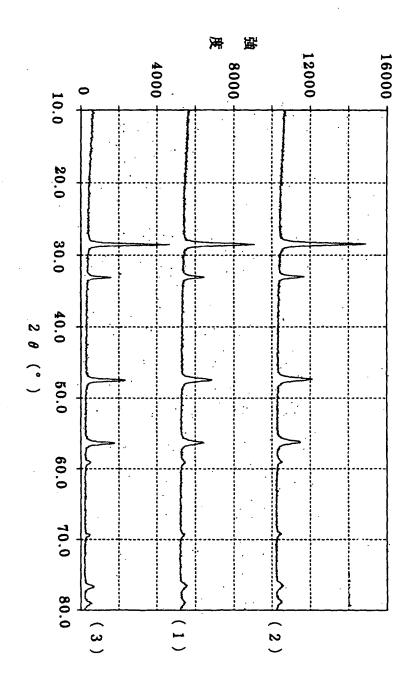
### 【図5】

比較例3で得られた粒子の粒子構造を示す透過型電子顕微鏡写真である。倍率 は5万倍である。

## 【符号の説明】

- (1) は実施例2で得られた粒子の粉末X線回折のパターンを示す。
- (2) は実施例3で得られた粒子の粉末X線回折のパターンを示す。
- (3) は比較例1で得られた粒子の粉末X線回折のパターンを示す。

【書類名】 図面 【図1】



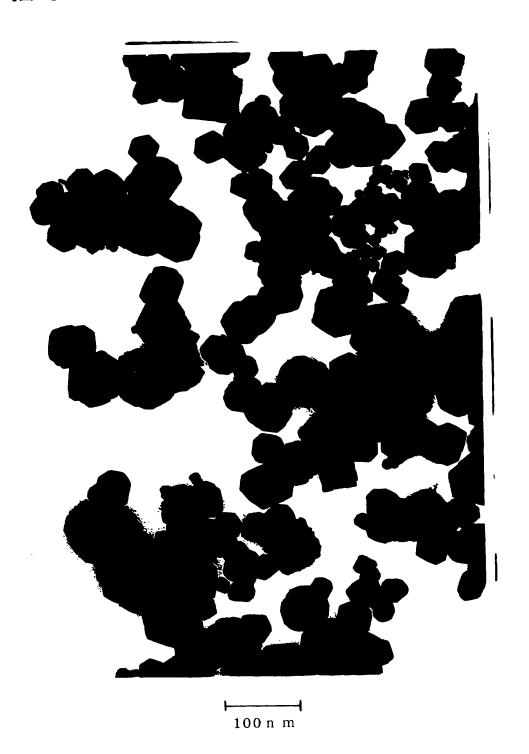
# 【図2】



# 【図3】



# 【図4】



# 【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 シリカを主成分とする基板の研磨、例えば水晶、フォトマスク用 石英ガラス、半導体デバイスの有機膜、層間絶縁膜及びトレンチ分離のCMP、 又はガラス製ハードディスクの研磨に用いられる研磨剤を提供する。

【解決手段】 0.005~1μmの粒子径を有し、且つNd/(Ce+Nd) モル比に換算して0.001~0.5の割合でネオジム化合物を成分に含有した酸化セリウムを主成分とする粒子を媒体に分散したゾル。セリウム(III)塩とネオジム(III)塩を混合した水溶液と、アルカリ性物質を反応させて水酸化セリウム(III)と水酸化ネオジム(III)が均一に混合された懸濁液を生成する工程、及び得られた懸濁液に酸素又は酸素を含有するガスを吹き込む工程を経由して得られる。

【選択図】 なし



# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

氏 名

日産化学工業株式会社